# Rec'd PET/PTS 29 DEC 2004

発信人 日本国特許庁 (国際予備審 )

	特許協力条約	4
])		
_		

出願人代理人		期限:/5年/月24日				
简井 大和				(26)		
殿あて名				,		
T 160-0023		PCT見解書				
東京都新宿区西新宿8丁目1番1号 アゼリ アビル3階 筒井国際特許事務所		(法第13条) [PCT規則66]				
, c., ora   m)  maxival 4-00)		発送日 (日. 月. 年) <b>26.11.02</b>				
出願人又は代理人 の書類記号 310200488971		応答期間	上記発送日から	2 月 <del>/目</del> 以内		
国際出願番号 PCT/JP02/08284 国際出願日 (日.月.年) 1	5.	08.02	優先日 (日.月.年)			
国際特許分類(IPC)						
Int. Cl' H01L29/78, H01L21/336, H01L21	/82	38, H01L27/092				
出願人(氏名又は名称) 株式会社日立製作所	,					
1. これは、この国際予備審査機関が作成した 1 回目の見解書である。     2. この見解書は、次の内容を含む。						
I X 見解の基礎						
II	つしい	ての目解の不作成				
IV 発明の単一性の欠如		C 47767447711177X				
V X 法第13条 (PCT規則66.2(a)(ii)) に規 、それを裏付けるための文献及び説明	定す	トる新規性、進歩ft	生又は産業上の利用可能	性についての見解		
VI  ある種の引用文献						
VII 国際出願の不備						
W [X] 国際出願に対する意見						
3. 出願人は、この見解書に応答することが求められる。   いつ? 上記応答期間を参照すること。この応答期間に間に合わないときは、出願人は、法第13条(PCT規則 66.2(d))に規定するとおり、その期間の経過前に国際予備審査機関に期間延長を請求することができる。   ただし、期間延長が認められるのは合理的な理由があり、かつスケジュールに余裕がある場合に限られることに注意されたい。						
どのように? 法第13条 (PCT規則66.3) の規定に従い、答弁書及び必要な場合には、補正書を提出する。補正書の 様式及び言語については、法施行規則第62条(PCT規則66.8及び66.9)を参照すること。						
なお 補正書を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2(PCT規則66.4)を参照すること。 補正書及び/又は答弁書の審査官による考慮については、PCT規則66.4の2を参照すること。審査官と						
の非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。 応答がないときは、国際予備審査報告は、この見解書に基づき作成される。						
4. 国際予備審査報告作成の最終期限は、PCT規則69.2の規定により 15.12.04 である。						
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	. 特	許庁審査官(権限 松嶋 タ		4 M 9 8)3 6		

様式PCT/IPEA/408 (表紙) (1998年7月)

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

(添付用紙の注意書きを参照)

電話番号 03-3581-1101 内線 3460

Ι.	5	見解の基礎						
1. この見解書は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この見解書において「出願時」とする。)								
	X 出願時の国際出願書類							
		明細書 明細書 明細書	第 第 第		_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と		
		請求の範囲 請求の範囲	第 		項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基	D	
	_	請求の範囲 請求の範囲	第 第		項、 項、 	国際予備審査の請求書と	付の書簡と共に提出されたもの	
		図面 図面 図面	第 第 第 ———		ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、			
		明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	リ表の部分	第	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と		
2.	_	上記の出願書類	質の言語は、	下記に示す場合を	, :除くほか、こ	の国際出願の言語である。		
	_	上記の書類は、	下記の言語	吾である		3.	·	
	<ul><li>□ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語</li><li>□ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語</li><li>□ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語</li></ul>							
3.	3	この国際出願に	は、ヌクレス	ナチド又はアミノ配	2配列を含んで	おり、次の配列表に基づき	き見解書を作成した。	
<ul> <li>□ この国際出願に含まれる書面による配列表</li> <li>□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表</li> <li>□ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表</li> <li>□ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表</li> <li>□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった</li> <li>□ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。</li> </ul>								
4.		献正により、7 明細書 請求の範囲	第		ページ 項		·	
<ul><li>□ 図面 図面の第 ページ/図</li><li>5. □ この見解書は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))</li></ul>								
					·			

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 る文献及び説明	E性についての法第13条	(PCT規則66.2(a)(ii)に定	める見解、それを裏付
1.	見解	•		
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	7-9, 15-17, 24 1-6, 10-14, 18-23	
	進歩性(IS)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	7-9, 15=173 1-6, 10-14, 18-24	
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-24	

#### 2. 文献及び説明

. )

文献 1: US 2002/0047170 A1(MITSUBISH) DENKI KABUSHIKI KAISHA) 2002. 04. 25-37 2002-1347

文献 3 : US 2001/0028093 A1 (HITACHI LTD. ) 2001. 10. 11→ TP 2001 - 224 23

文献 4: JP 2002-217414 A(松下電器産業株式会社) 2002.08.02

請求の範囲1-6,10-14,18-23

請求の範囲1-6, 10-14, 18-23に記載された発明は、文献1から新規性を有さない。

請求の範囲1-6, 10-14, 18-23に記載された「絶縁膜をマスクに、前記導電性膜をエッチングすることにより導体片を形成する工程」は、文献1の「ハードマスクパターン5aをマスクとして、ポリシリコン層4をエッチングする」工程に相当する。

### 請求の範囲24

請求の範囲24に記載された発明は、文献1及び2より進歩性を有さない。 文献1には、「前記第1半導体領域の深さは、前記第2半導体領域より深いこと」について開示されていないが、文献2には、本願発明と同様、高電圧用MOSFETと低電圧用MOSFETにおいて、高電圧用MOSFETの拡散層の深さが低電圧用MOSFETの拡散層の深さよりも深いことが開示されている。

よって、文献1に記載の「高電圧用MOSトランジスタQ1」の拡散層の深さ及び「低電圧用MOSトランジスタQ2」の拡散層の深さの相対関係を文献2に開示された関係にすることは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

#### WI. 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲24に記載された「前記第1半導体領域の深さは、前記第2半導体領域より深いこと」に対応する構成が明細書中に記載されていない。したがって、本願の請求の範囲24は明細書により十分な裏付けをされていないものである。

#### 補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

#### 第 V.2. 欄の続き

請求の範囲1-5, 18-21

請求の範囲1-5, 18-21に記載された発明は、文献3から新規性を有さない。

請求の範囲1-5,18-21に記載された「高誘電率絶縁膜は、比誘電率が2.0以上の膜であること」及び「絶縁膜をマスクに、前記導電性膜をエッチングすることにより導体片を形成する工程」は、文献3の「酸化シリコン膜」、「酸窒化シリコン膜」又は「窒化シリコン膜」及び「絶縁膜16をエッチングマスクとして、そこから露出するゲート電極形成膜15をドライエッチング法等によってエッチング除去する」工程に相当する。

## 請求の範囲1-4, 18-21

請求の範囲1-4,18-21に記載された発明は、文献4から新規性を有さない。

請求の範囲1-4, 18-21に記載された「高誘電率絶縁膜は、比誘電率が 2. 0以上の膜であること」及び「絶縁膜をマスクに、前記導電性膜をエッチングすることにより導体片を形成する工程」は、文献 4 の熱酸化法により形成した「ゲート酸化膜」及び「BPSG膜 14 をマスクとして、p o 1 y - S i 膜 1 3 のドライエッチングを行う」工程に相当する。

## 請求の範囲7-9,15-17

請求の範囲 7-9, 15-17 に記載された発明は、文献 1 乃至 4 に対して新規性及び進歩性を有する。

文献1乃至4には、「導体片をマスクに、前記高誘電率絶縁膜を除去する工程」及び「前記導体片および前記側壁膜をマスクに、前記高誘電率絶縁膜を除去する工程であって、前記導体片および前記側壁膜に対する前記高誘電率絶縁膜のエッチングの選択比が大きい条件でエッチングする工程」について記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

, , %

1 \_

提出書類の様式及び作成要領につい

答弁書及び手続補正書は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第62条(様式第23)及び同 規則第31条(様式15)に従って作成して下さい。

14 国名を記載する場合においては、1981パロコパルローパーループングを表する。
15 「代型人」の欄には、その氏名の配線に合わせて、その氏名の前に「弁護士」、「弁型士」又は「法定代理人」のうち該当するものを記載する。
16 代理人によるときは本人の印は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の個を設けるには及ばない。
17 各用紙においては、原則として採削、訂正、重ね書き及び行間利入を行ってはならない。
18 等弁密の用紙は、容易に分離し、又はとじ直すことができるように例えばクリップ等を用いてとじる。

しとしる。 「あて名」は出願人、代表者、代现人又は復代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載す

)「あて名」は出願人、代表者、代理人又は復代理人か人ことによってのよう。 る。 の「復代理人」の欄には、その氏名の記載に合わせて、その氏名の前に「弁護士」又は「弁理士」のうち該当するものを記載する。 1 復代理人によるときは代理人の印は不要とし、復代理人によらないときは「復代理人」の 個を散けるには及ばない。 2 日付は、西部紀元及びグレゴリー暦により、日についての数字、月についての数字及び年 についての及後から2つの数字をこの順序に従ってそれぞれについて2桁のアラビア数字で 没示し、かつ、日及び月の数字の後にビリオドを付す(例えば1978年3月30日は「3 0.03.78」)。他の紀元又は層を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日 付を併記する。

模式第23 (第62条関係) 弁 特許庁審査官 国際出版の表示 国際出版の表示 出版人(代表名) 氏名(名称) あて名 国籍 住事 人理人 氏名 へて 容弁の内容 係付む類の目録

陳述哲

特許庁長官 殿 本事に張付したフレキシブルディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、明知市に 記憶した塩基配列又はアミノ酸配列を忠実にコード化したものであって、内容を変更したも のでないことを陳述します。 平成 年 月 日

国際出願の表示

国際出願の表示
発明の名称
発明の名称
特許出願人・代理人
ハ (印)
ハ (フレキシンルディスクの記録形式等の情報を記載した告面」は、原則として、「出願人
氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用
した文字コード」、「起列を記録したファイル名」及び「理絡先(電話番号及び担当者の氏
名)」の項目を設けて記録することにより作成する。
ニ 「6 補正の対象」及び「6 補正の内容」の欄は設けない。
「 第50条の3第5項の規定による命令に基づき配列表を記載した告面を提出するときは、「
7 循行管項の目録」の欄に次のように記載し、「5 補正の対象」及び「6 補正の内容」の欄は設けない。
「 6 衛行管項の目録 1 配列表を記載した否面

17

21 国名を配収する場合においては、マルバルロコーニーステム。
示する。
22 「代理人」の間には、その氏名の記載に合わせて、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」
又は「法定代理人」のうち該当するものを記載する。
23 代理人によるときは本人の印は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の概を数ける
には及ばない。
24 各別紙においては、原則として採門、訂正、重ね事き及び行門挿入を行ってはならない。
25 手权補正否の用紙は、容易に分離し、又はとじ直すことができるように例えばクリップ等を
用いてとじる。

25 手数側近近型が用車は、分割下刀削し、ヘルモンロン、ことが、ことが、このにはいいには、 用いてとじる。 26 「あて名」は出顧人、代表者、代理人又は復代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載する

・「復代型人」の個には、その氏名の記載に合わせて、その氏名の前に「弁護士」又は「弁理士」のうち譲当するものを記載する。 は、のうち譲当するものを記載する。 「復代型人によるときは代型人の印は不要とし、復代型人によらないときは「復代理人」の概 を設けるには及ばない。

を設けるには及ばない。 9 目付は、西暦紀及びグレゴリー暦により、日についての数字、月についての数字及び年に ついての及後から2つの数字をこの順序に従ってそれぞれについて2桁のアラビア数字で扱示 し、かつ、日及び月の数字の後にビリオドを付す(何えば1978年3月30日は「30.0 3.78」)。他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併 記する。

模式第15 (第31条関係) Œ 22 初 33 特許庁長官 (特許庁審査官 政 級) 1 国際出額の表示 2 出願人(代表省) 氏名(名称) あて名 国第 住所 3 代理人